

令和3年12月

Photomask Japan 組織委員会  
委員長 渡邊 健夫

## 国際ホトマスクシンポジウム(Photomask Japan)へのご協力をお願い

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

さて、Photomask Japanはホトマスクジャパン(PMJ)とSPIE(The International Society for Optical Engineering)の主催、BACUS、EMLCの共催を得て、マスクに関する総合的かつ実用的な国際会議として組織されたものです。本会議は毎年4月に開催しており、2022年は4月26日から28日にオンラインでのデジタルフォーラムとして開催します。

COVID-19の蔓延により日常社会におけるデジタル化が一気に進み、半導体デバイスの高性能化による5G通信、AI、IoT、車の自動運転などのあらゆる分野での高度情報化と共に、SDGs達成に向けた流れが加速しています。先端デバイスの微細化においてはEUVリソグラフィー(EUVL)の適用が開始され、地政学リスク回避のため国家レベルの多額投資を控え半導体業界は大きな潮目を迎えています。また、パワー系をはじめとする非先端半導体デバイスの市場も拡大しており、半導体産業全体としては今後も大きく伸張するものと思われま

す。EUVLはこの先の微細化を担う最もキーとなる製造技術であり、日本には欠かせない関連サプライヤーが数多く存在し、そのサプライチェーンを担っています。マスク関連においてもペリクルを始め、材料・加工プロセス・欠陥検査・修正技術など、未だ解決すべき課題も少なくありません。更には高NA化に向けた課題も挙げられています。また、マルチパターンニング、コンピューテーショナルリソグラフィーなどに対応したマスク関連技術開発も要求されており、デバイスの大容量化や曲線表現等によりマスク描画やデータの高速・高精度処理は益々重要な位置付けとなっています。

一方、カーボンニュートラルの観点から注目されるナノインプリントリソグラフィー(NIL)も、テンプレートが重要な要素技術です。更にはデバイスニーズに応じて多様化するパターンニング技術にも幅広く応えていく必要があり、加工プロセスや計測技術などは半導体ウエハ製造技術との交流も不可欠となっています。

マスク技術開発は、ウエハ技術に比べてその市場規模が小さいことから、製造装置、材料、プロセス、EDA等の広範囲な要素技術に対して開発リソースが限られていることが課題です。これらの技術課題の解決と、高精度化・多機能化・多様化するマスクをタイムリーに、かつ低コストで提供していくためには、実用的な観点から関連分野の研究・技術情報を幅広く交換していくことが必要であり、本会議の性格として実用性を重視したいと考えています。

日本のマスク関連技術は世界をリードする立場にあり、半導体覇権における戦略的対応と技術発信の重要性が問われる中、業界への貢献が期待されます。また、国内で国際会議を開催することは国際間の技術交流、国際協調に寄与する上からも意義が大きいと考えられます。

つきましては、本会議開催の趣旨とその重要性をご賢察いただき、下記のように貴社のご援助、ご高配を賜りたくお願い申し上げます。

なお、Photomask Japan 2022に対しての寄付によるご援助と、Photomask Japan(2022年度)賛助会員としてのご援助の二通りの方法がございます。貴社のご都合に合った方法でご協力いただければ幸いです。

会議の情報、Digest of Papers(予稿集)、会務の報告等は、賛助、寄付のいずれの場合につきましても送付させていただきます。よろしくご理解の程お願い申し上げます。

敬具

## 記

1. 賛助会入会の場合は、添付の「賛助会入会申込書」によりお願い申し上げます。

ご寄付いただく場合は、同封の「寄付申込書」によりお願い申し上げます。

2. 払込方法： 下記の口座にお振り込みください。

銀行名： 三菱UFJ銀行  
支店名： 新丸の内支店 (店番号 422)  
口座番号: (普) 4 9 1 0 5 2 5  
口座名： Photomask Japan  
口座名フリガナ： ホトマスクジャパン

3. 本件照会先、申込書送付先

ホトマスクジャパン事務局

〒105-8335

東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

(株)JTBコミュニケーションデザイン内

FAX: 03-3452-8550

E-mail: pmj@jtbcom.co.jp

4. お申込期限 2022年4月22日(金)

※2022年2月25日(金)までにお申込の場合は、「Digest of Papers」(予稿集)に社名を掲載いたします。

5. お振込期限 2022年4月22日(金)

以上

添付書類 (1) Photomask Japan 2022 開催趣意書  
(2) Photomask Japan 賛助会規程  
(3) Photomask Japan 賛助会入会申込書(2022年度)  
(4) Photomask Japan 2022 寄付申込書